

МАТЕРИАЛЫ ЭЛЕКТРОНИКИ

lize sharp impurity boundary between the layers of p- and n-type conductivity. The method of forming sharp hetero boundaries in p-GaAs:Zn/n-GaAs:Si systems can be used for manufacturing wide range of epitaxial structures.

Keywords: epitaxial layer, gallium arsenide, MOCVD, heteroboundary, rare-earth element, doping.

REFERENCES

1. V. Petrova-Koch, R. Hezel, A. Gotszberger. *High-efficient low cost photovoltaics*. Springer, 2009.
2. Dong J. R., Teng J. H., S. J. Chua, Foo B. C., Y. J. Wang, R. Yin. MOCVD growth of 980 nm InGaAs/GaAs/AlGaAs graded index separate confinement heterostructure quantum well lasers with tertiarybutylarsine. *Journal of Crystal Growth*, 2006, vol. 289, iss. 1, pp. 59-62. DOI: 10.1016/j.jcrysGro.2005.10.138
3. Shastry S. K., Zemon S., Kenneson D. G., Lambert G. Control of residual imurities in very high purity GaAs grown by organometallic vapor phase epitaxy. *Appl. Phys. Lett.*, 1988, vol. 52, iss. 2, p. 150. DOI: 10.1063/1.99034
4. Shunro Fuke, Masasi Umemura, Naoshi Yamada, Kazuhiro Kuwahara, Tetsuji Imai. Morphology of GaAs homoepitaxial layer grown on (111)A substrate planes by organometallic vapor phase deposition. *Journal of Applied Physics*, 1990, vol. 68, iss. 1, pp. 97-100. DOI: 10.1063/1.347076
5. Masashi Umemura, Kazuhiro Kuwahara, Shunro Fuke, Masahiro Sato and Tetsuji Imai. Morphology of AlGaAs layer grown on GaAs(111)A substrate plane by organometallic vapor phase epitaxy. *J. Appl. Phys.*, 1992, vol. 72, iss. 1, p. 313. DOI: 10.1063/1.352141
6. Hanna M. C., Lu Z. H., Majerfeld A. Very high carbon incorporation in metalorganic vapor phase epitaxy of heavily doped p-type GaAs. *Appl. Phys. Lett.*, 1991, vol. 58, iss. 2, p. 164. DOI: 10.1063/1.104960
7. Watanabe N., Ito H. Saturation of hole concentration in carbon-doped GaAs grown by metalorganic chemical vapour deposition. *J. C. Cryst. Growth*, 1997, vol. 182, no 1-2, pp. 30-36. DOI: 10.1016/S0022-0248(97)00333-3
8. Hanna M. C., Lu Z. H., Oh E. G., Mao E., Majerfeld A. Atmospheric pressure organometallic vapor phase epitaxy growth of high-mobility GaAs using trimethylgallium and arsine. *Appl. Phys. Lett.*, 1990, vol. 57, iss. 11, p. 1120. DOI: 10.1063/1.103509
9. Marmalyuk A. A. *Materialy Elektronnoi Tekhniki* [Materials of Electronic Technics], 2005, no 1, pp. 17-23.
10. Marmalyuk A. A. *Materialy Elektronnoi Tekhniki* [Materials of Electronic Technics], 2004, no 3, pp 14-18.

РЕЦЕНЗЕНТЫ НОМЕРА

Баранов Валентин Владимирович, докт. техн. наук, профессор, Белорусский государственный университет информатики и радиоэлектроники, г. Минск

Бондаренко Александр Федорович, канд. тех. наук, доцент, Донбасский государственный технический университет, г. Алчевск

Гавриши Василий Иванович, докт. техн. наук, доцент, Национальный университет «Львовская политехника»
Глушеченко Эдуард Николаевич, канд. техн. наук, начальник отдела, Научно-производственное предприятие «Сатурн», г. Киев

Кадацкий Анатолий Федорович, докт. техн. наук, зав. кафедрой, ОНAC им. А. С. Попова, г. Одесса
Карушкин Николай Федорович, канд. техн. наук, начальник отдела, НИИ «Орион», г. Киев

Ковалюк Захарий Дмитриевич, докт. физ.-мат. наук, руководитель Черновицкого отделения Института проблем материаловедения им. И. Н. Францевича НАНУ

Круковский Семен Иванович, докт. техн. наук, нач. сектора, НПП «Карат», г. Львов

Кудрик Ярослав Ярославович, канд. техн. наук, старший научный сотрудник, Институт физики полупроводников им. В. Е. Лашкарева НАНУ, г. Киев

Николаенко Юрий Егорович, докт. техн. наук, ведущий научный сотрудник, НТУУ «Киевский политехнический институт»

Панов Леонид Иванович, канд. техн. наук, профессор, Одесский национальный политехнический университет

Перевертайло Владимир Леонтьевич, канд. физ-мат. наук, зам. директора по научной работе, НИИ микроприборов НТК «ИМК» НАНУ, г. Киев

Потий Александр Владимирович, докт. техн. наук, начальник кафедры, Харьковский университет воздушных сил

Старostenko Владимир Викторович, докт. физ.-мат. наук, профессор, Таврический НУ им. Вернадского, г. Симферополь

Стевич Зоран, докт. техн. наук, профессор, Технический факультет в Боре Белградского университета

Трофимов Владимир Евгеньевич, канд. техн. наук, доцент, Одесский национальный политехнический университет

Хайрнасов Сергей Манисович, канд. техн. наук, старший научный сотрудник, НТУУ «Киевский политехнический институт»

Цибрий Зиновия Федоровна, канд. физ.-мат. наук, старший научный сотрудник, Институт физики полупроводников им. В. Е. Лашкарева НАНУ, г. Киев

Чечельницкий Виктор Яковлевич, докт. техн. наук, директор факультета, Одесский национальный политехнический университет

Щербакова Галина Юрьевна, канд. техн. наук, доцент, Одесский национальный политехнический университет